

质疑函

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：桂林皓璟照明科技有限公司

地址：桂林市七星区环城北二路东城雅苑12栋3住所6-1号

邮编：541004

联系人：罗广林

联系电话：182 9389

授权代表：/

联系电话：/

地址：/

邮编：/

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：桂林市产品质量检验所检验设备采购

质疑项目的编号：GLZC2025-J1-990398-GXZC

采购人名称：桂林市产品质量检验所

质疑事项：

☒ 谈判文件 谈判文件获取日期：2025年8月13日

☐ 采购过程

☐ 成交结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：关于“温度控制系统”采购程序违规的问题

谈判文件第三章“采购需求”中“电感耦合等离子体质

谱仪”技术参数“八、配件及耗材要求（除主机包含以外）”第 15 条载明：“温度控制系统 1 套：可冷暖控制，制冷量 7000~7500W；嵌入式；变频；能效比 3.2 以上”。该采购需求未能明确真实或清晰表述实际采购需求，从参数匹配描述更像是空调或制冷设备，若是则应依法纳入政府集中采购范围，但本项目将其作为检验设备配件通过竞争性谈判采购，违反政府采购程序规定。

事实依据：

1、设备属性认定：根据谈判文件第三章“采购需求”对该设备的参数描述，“可冷暖控制”“制冷量”“变频”等核心特征，完全符合《政府采购品目分类目录》中“空调机”（品目代码 A020618）的定义，属于典型的空调产品，而非检验设备专用配件。

2、政策依据冲突：谈判文件第一章“竞争性谈判公告”第七条“其他补充事宜”第 2 点“需要落实的政府采购政策”第（4）项明确引用《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号），该文件规定“空调机属于政府强制采购节能产品”。同时，谈判文件第三章“采购需求”说明第 4 条明确“采购需求中出现的品牌、型号或生产供应商仅起参考作用”，但未按强制采购要求将空调产品纳入集中采购程序。

3、程序违规表现：根据《政府采购法》及集中采购相

关规定，空调属于集中采购目录内品目，应委托集中采购机构代理采购。但本项目将其拆分至“检验设备采购”中，以“温度控制系统”名义规避集中采购，违反法定采购程序。

法律依据：

1、谈判文件第二章“供应商须知”第 8.3 条：“供应商必须仔细阅读招标文件的所有内容，按照谈判文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。”此条款同样约束采购人需确保采购程序合法合规，不得通过拆分品目规避集中采购。

2、《中华人民共和国政府采购法》第十八条“采购人采购纳入集中采购目录的政府采购项目，必须委托集中采购机构代理采购。”

质疑事项 2：采购需求中关于电感耦合等离子体质谱仪的多项技术参数描述属于安捷伦品牌的独有参数，构成对其他供应商的歧视性条款，限制了公平竞争。具体包括：

1、技术参数“三、硬件参数要求”第 5.2 条“采样锥孔径 ≤ 1.0 mm，截取锥孔径 ≤ 0.45 mm（需提供实物图，否则投标无效）”。

2、技术参数“三、硬件参数要求”第 6 条“软件可直接设置稀释倍数 ≥ 90 倍（需提供软件截图，否则投标无效）”。

3、技术参数“三、硬件参数要求”第 8 条“必须具备屏蔽炬物理接地技术（需提供实物图，否则投标无效）”。

4、技术参数“三、硬件参数要求”第10.2条“碰撞反应池控温范围 55~95℃，0.1℃步进可调（需提供软件截图，否则投标无效）”。

5、技术参数“三、硬件参数要求”第10.4条“He 气最高流速 ≥ 12 mL/min（需提供软件截图，否则投标无效）”。

事实依据：

1、参数与特定品牌的唯一性关联：经核查安捷伦产品手册（链接：

https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=G1833-65419&catId=SubCat2ECS_1051512），其电感耦合等离子体质谱仪的核心参数与上述条款完全匹配：

1.1 采样锥孔径为 0.8mm、截取锥孔径为 0.4mm，是目前市场上唯一满足“ ≤ 1.0 mm 和 ≤ 0.45 mm”的产品。（附件1）

1.2 高盐进样系统软件默认最大稀释倍数为 90 倍，与技术参数“三、硬件参数要求”第 6 条完全一致。其他品牌最高仅支持 60 倍。（附件 2）

1.3 屏蔽炬物理接地技术为安捷伦专利，其他品牌均采用虚拟接地技术，被本文件直接排除（技术参数“三、硬件参数要求”第 8 条）；

1.4 碰撞反应池温控范围 55~95℃ He 气最高流速 12mL/min 均为安捷伦独家配置。

2、佐证材料要求的排他性：上述条款均设置“必须提

供特定截图或实物图否则投标无效”的强制性要求，而此类材料仅安捷伦能提供，其他供应商因技术差异无法满足，实质形成对特定品牌的定向采购。

3、与文件原则冲突：谈判文件第三章“采购需求”说明第四条明确“采购需求中出现的品牌、型号仅起参考作用，不属于指定品牌”，但上述参数通过技术壁垒排除其他品牌，与该说明直接矛盾。

法律依据：

1、《中华人民共和国政府采购法》第二十二条：“采购人不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。”

2、该文件第四章“评审办法”第一条“评审应坚持公平、公正、科学和择优的原则”，上述参数设置明显违背该原则，限制了合格供应商范围。

3、谈判文件第二章“供应商须知”第8.2条“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。”此条款旨在禁止关联供应商排他竞争，而本项目通过参数设置实现品牌排他，违反该原则。

质疑事项 3：关于“打印机” 采购程序违规的问题

谈判文件第三章“采购需求”中包含“打印机”采购条目（如：“打印机 1 台，配置为 A4 黑白激光、自动双面打

印、网络连接功能”，需根据招标文件实际内容补充）。该设备属于《政府采购品目分类目录》明确的政府集中采购品目，但本项目将其与检验设备合并通过竞争性谈判采购，违反法定程序。

事实依据：

1、品目属性判定：根据《政府采购品目分类目录》（财库〔2020〕38号），“A020106 打印机”明确列入政府集中采购目录（无论品牌、功能，只要属于打印机品目，均属集中采购范畴）。本项目采购的打印机完全符合该品目定义。

2、程序违规表现：《政府采购法》规定，纳入集中采购目录的项目必须委托集中采购机构代理采购。但本项目中：采购人未将打印机单独委托集中采购机构，而是将其与检验设备合并，通过竞争性谈判（非集中采购程序）采购，属于拆分集中采购品目、规避法定采购程序的行为。

3、政策冲突验证：谈判文件第一章“竞争性谈判公告”明确采购方式为竞争性谈判，但未说明集中采购机构参与代理，结合品目属性，进一步证明程序违规。

法律依据：

1、《中华人民共和国政府采购法》第十八条：“采购人采购纳入集中采购目录的政府采购项目，必须委托集中采购机构代理采购。”

2、《政府采购品目分类目录》（财库〔2020〕38号）：

明确“A020106 打印机”为集中采购品目，采购人应遵循集中采购程序。

四、与质疑事项相关的质疑请求：

1、请求确认“温度控制系统”属于空调产品，责令采购人按政府集中采购程序重新组织该部分采购，并修正谈判文件相应内容。

2、请求删除或修改上述具有排他性的技术参数及佐证材料要求，确保所有符合资质的供应商能够公平参与竞争。

3、请求确认“打印机”属于政府集中采购品目，责令采购人：按集中采购程序重新组织打印机采购（委托集中采购机构代理），修正谈判文件，将打印机从本次竞争性谈判包中剥离。

4、请求采购人及采购代理机构在法定期限内就上述质疑事项作出书面答复，并提供相关政策依据及修正方案。

附件 1： 安捷伦 7850 ICP-MS 采样锥/截取锥参数（第 5.2 条）

附件 2： 安捷伦 UHMI 100 倍稀释技术（第 6 条）

签字（签章）：马广林



日期：2015.8.14

附件 1: 安捷伦 7850 ICP-MS 采样锥/截取锥参数 (第 5.2 条)

☆ 07-01-03 Agilent 7850 × 07-01-02 Agilent 7850 ICP-MS... 07-01-06 Agilent 7900 ICP-MS... + Create ? S Convert E-Sign Find text or tools													
Sample introduction system <table> <tr> <td>Peristaltic pump</td><td>10-roller, 3 channels</td></tr> <tr> <td>Nebulizer</td><td>MicroMist (borosilicate glass)</td></tr> <tr> <td>Spray chamber</td><td>Scott-type double-pass (quartz) Controlled temperature range: -5 °C to +20 °C</td></tr> <tr> <td>Ultra High Matrix Introduction (UHMI) system</td><td>Included</td></tr> </table>		Peristaltic pump	10-roller, 3 channels	Nebulizer	MicroMist (borosilicate glass)	Spray chamber	Scott-type double-pass (quartz) Controlled temperature range: -5 °C to +20 °C	Ultra High Matrix Introduction (UHMI) system	Included				
Peristaltic pump	10-roller, 3 channels												
Nebulizer	MicroMist (borosilicate glass)												
Spray chamber	Scott-type double-pass (quartz) Controlled temperature range: -5 °C to +20 °C												
Ultra High Matrix Introduction (UHMI) system	Included												
Plasma <table> <tr> <td>RF generator</td><td>Solid state digital drive 27 MHz Variable-frequency impedance matching 500 W to 1600 W</td></tr> <tr> <td>Torch</td><td>One-piece (quartz) 2.5 mm ID injector Shield Torch system</td></tr> <tr> <td>Torch position</td><td>Horizontal and vertical position: ±2 mm, in 0.1 mm steps Sampling depth: 3 to 28 mm, in 0.1 mm steps</td></tr> <tr> <td>Mass flow controllers (Ar)</td><td>4: Plasma, Aux., Carrier, Make up/Dilution</td></tr> <tr> <td>5th gas line for alternative carrier gas</td><td>Optional</td></tr> </table>		RF generator	Solid state digital drive 27 MHz Variable-frequency impedance matching 500 W to 1600 W	Torch	One-piece (quartz) 2.5 mm ID injector Shield Torch system	Torch position	Horizontal and vertical position: ±2 mm, in 0.1 mm steps Sampling depth: 3 to 28 mm, in 0.1 mm steps	Mass flow controllers (Ar)	4: Plasma, Aux., Carrier, Make up/Dilution	5th gas line for alternative carrier gas	Optional		
RF generator	Solid state digital drive 27 MHz Variable-frequency impedance matching 500 W to 1600 W												
Torch	One-piece (quartz) 2.5 mm ID injector Shield Torch system												
Torch position	Horizontal and vertical position: ±2 mm, in 0.1 mm steps Sampling depth: 3 to 28 mm, in 0.1 mm steps												
Mass flow controllers (Ar)	4: Plasma, Aux., Carrier, Make up/Dilution												
5th gas line for alternative carrier gas	Optional												
Interface <table> <tr> <td>Sampling cone</td><td>1 mm diameter orifice Standard: Ni-tipped with Cu base Optional: Pt-tipped with Cu base</td></tr> <tr> <td>Skimmer cone</td><td>0.4 mm diameter orifice Standard: Ni Optional: Pt-tipped with Cu base</td></tr> </table>		Sampling cone	1 mm diameter orifice Standard: Ni-tipped with Cu base Optional: Pt-tipped with Cu base	Skimmer cone	0.4 mm diameter orifice Standard: Ni Optional: Pt-tipped with Cu base								
Sampling cone	1 mm diameter orifice Standard: Ni-tipped with Cu base Optional: Pt-tipped with Cu base												
Skimmer cone	0.4 mm diameter orifice Standard: Ni Optional: Pt-tipped with Cu base												
Ion lens													
Configuration <table> <tr> <td>Configuration</td><td>Orthogonal Detector System (ODS)</td></tr> <tr> <td>Detector</td><td>Dual-mode discrete dynode electron multiplier</td></tr> <tr> <td>Dynamic range</td><td>10 orders (0.3 cps to 4 Gcps)</td></tr> <tr> <td>Minimum integration time</td><td>100 µs</td></tr> <tr> <td>Minimum dwell time (TRA mode)</td><td>3 ms (standard), 0.1 ms (optional)</td></tr> </table>		Configuration	Orthogonal Detector System (ODS)	Detector	Dual-mode discrete dynode electron multiplier	Dynamic range	10 orders (0.3 cps to 4 Gcps)	Minimum integration time	100 µs	Minimum dwell time (TRA mode)	3 ms (standard), 0.1 ms (optional)		
Configuration	Orthogonal Detector System (ODS)												
Detector	Dual-mode discrete dynode electron multiplier												
Dynamic range	10 orders (0.3 cps to 4 Gcps)												
Minimum integration time	100 µs												
Minimum dwell time (TRA mode)	3 ms (standard), 0.1 ms (optional)												
Vacuum system <table> <tr> <td>Configuration</td><td>Three-stage differential vacuum system</td></tr> <tr> <td>Vacuum pump</td><td>Single split-flow turbo molecular pump Single external rotary pump</td></tr> <tr> <td>Vacuum pump hose length</td><td>1.5 m, 3 m (optional)</td></tr> </table>		Configuration	Three-stage differential vacuum system	Vacuum pump	Single split-flow turbo molecular pump Single external rotary pump	Vacuum pump hose length	1.5 m, 3 m (optional)						
Configuration	Three-stage differential vacuum system												
Vacuum pump	Single split-flow turbo molecular pump Single external rotary pump												
Vacuum pump hose length	1.5 m, 3 m (optional)												
Software <table> <tr> <td>Instrument control software</td><td>ICP-MS MassHunter Workstation software</td></tr> <tr> <td>User access control software</td><td>Optional</td></tr> <tr> <td>Chromatographic software</td><td>Optional</td></tr> <tr> <td>Single nanoparticle application module</td><td>Optional</td></tr> <tr> <td>Intelligent sequencing software</td><td>Optional</td></tr> <tr> <td>Three offline user licenses</td><td>Optional</td></tr> </table>		Instrument control software	ICP-MS MassHunter Workstation software	User access control software	Optional	Chromatographic software	Optional	Single nanoparticle application module	Optional	Intelligent sequencing software	Optional	Three offline user licenses	Optional
Instrument control software	ICP-MS MassHunter Workstation software												
User access control software	Optional												
Chromatographic software	Optional												
Single nanoparticle application module	Optional												
Intelligent sequencing software	Optional												
Three offline user licenses	Optional												
Accessories and peripherals Autosamplers Agilent SPS 4 Autosampler Agilent Integrated Autosampler (I-AS) Sample introduction Integrated Sample Introduction System 3 PFA Inert Sample Introduction Kit													



附件 2: 安捷伦 UHMI 100 倍稀释技术 (第 6 条)



安捷伦高基质进样 (HMI) 气溶胶稀释技术的优势

集成

安捷伦 HMI 系统全面集成到 ICP-MS 硬件和软件中。所有安捷伦 ICP-MS 系统均可对雾化气和补偿气/稀释气流速实现单独控制。

优化

HMI 使用专利算法控制等离子体设置和气溶胶稀释。通过特殊气体端口接头将氦气稀释气流添加到气溶胶流中。

自动化

雾化气与稀释气的比例可自动调节, 以确定气溶胶稀释的程度 (对于超高基质进样 — UHMI 可高达 100 倍稀释)。

等离子体预设条件可自动选择等离子体参数 (雾化气和补偿气/稀释气流速、采样深度、RF 功率), 从而提供一组易于选择的已校准等离子体条件。

可靠

在测量高基质和复杂样品时, 稳定且可重现的 HMI 设置可大大简化 ICP-MS 设置过程。

利用 HMI 简化高基质分析

传统 ICP-MS 处理的样品中总溶解固体 (TDS) 含量最高可达 2000 ppm (0.2%)。如果高出这一限值, 等离子体就无法完全分解基质, 未解离的基质便会沉积在接口锥和离子透镜上。这些沉积物会导致信号漂移并使维护更加频繁。不完全的基质分解也会增加干扰。

安捷伦 ICP-MS 系统具备所有 ICP-MS 中最稳定的等离子体, 最低的 CeO/Ce 比可以体现这一点。而含百分水平 TDS 的样品则需要稀释。液体稀释 (手动或使用自动稀释工具) 存在局限性, 且会增加硬件或人工成本。安捷伦 HMI 系统利用自动气溶胶稀释, 提供了一种更出色、更简单、更可靠的方法。

HMI 使用同一硬件处理低基质和高基质样品, 添加精确控制与经过校准的氦气流对气溶胶流进行稀释。这种稀释气可降低气溶胶的密度并打碎液滴, 从而获得更高的等离子体温度、更出色的基质分解、更低的氧化物和其他干扰, 以及更低的维护频率。

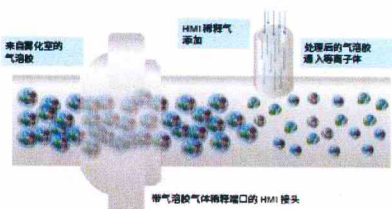


图 1. 带气溶胶稀释端口的安捷伦 HMI 接头。HMI 可稀释并打碎气溶胶液滴, 使等离子体更容易干燥并分解气溶胶。